Publication number: 02-138459

Date of publication of application: 28.05.1990

Application number: 63-289735

Date of filing: 16.11.1988

## LAMINATED HARD MATERIAL AND PRODUCTION THEREOF

### ABSTRACT

PURPOSE: To simply produce a laminated hard material with a well adhered multiple coating film having superior oxidation and machining resistances by coating a base material with a multiple coating film having (Ti, Al) N type structure contg. Al whose content has been stepwise or continuously increased from the base material side.

CONSTITUTION: Ti and Al are vapor-deposited on a base material and simultaneously the base material is irradiated with nitrogen ions from an ion source. By this ion mixing method, a multiple coating film having (Ti, Al) N type structure contg. Al whose content has been stepwise or continuously increased from the base material side is formed on the base material. The cracking and peeling of the coating film due to an extreme difference in compsn. at the interface between the base material and the coating film is prevented and a laminated hard material suitable for wear resistant parts, a cutting tool, etc., is simply obtd.

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-138459

(5) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)5月28日

C 23 C 14/06 C 01 B 21/06 8722-4K A 7508-4G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

**図発明の名称** 複合硬質材料及びその製造方法

②特 頤 昭63-289735

@出 願 昭63(1988)11月16日

**70発明者林常昭東京** 

常 昭 東京都港区西新橋1-7-2 虎ノ門高木ピル2階 株式

会社ライムズ内

⑦発明者 飛田 修司 東京都港区西新橋1-7-2 虎ノ門高木ビル2階株式

会社ライムズ内

⑪出 顋 人 株式会社ライムズ 東京都港区西新橋1-7-2 虎ノ門高木ビル2階

個代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明 細 音

1. 発明の名称

複合硬質材料及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1). 茲材上に、 該基材側から A 2 量を 段 階 的 も しくは連続的に 増加させた ( T ) 、 A 2 ) N 系 の 組 成構造を 有する 複合 被 膜を 被 置 したこと を 特 欲 とする 複合 便質材料。
- (2). 基材上にTI及びAVを蒸発すると同時にイオン源より窒素イオンを照射するイオンミキシング法により接基材剛からAV屋を段階的もしくは連続的に増加させた(TI、AV)N系の組成構造を有する複合被膜を形成することを特徴とする複合硬質材料の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、複合硬質材料及びその製造方法に関し、特に耐酸化性の優れた複合硬質材料及びその製造方法に係わる。

「従来の技術及び課題」

耐熱性が高く、硬質であるTiNは、従来より程々の基材上に被覆してその特段である耐熱性、
耐解耗性を基材に付与することが行われ、かつ各方面で実用化されている。特に、高速度調、超硬合金にTiN膜を被覆した複合硬質材料は耐摩托部品、切削工具等で長年に亙って実績を上げてきている。しかしながら、工業的利用の面から更に

苛酷な使用条件に耐える複合硬質材料が要望されている。

上述した要望から、最近、Ti(C・N)、(Ti、Hr)N、(Ti、Zr)N等の3元系の複合材料が検討され、夫々の元素の特長を生かした特性を有する材料の開発が行われている。

一方、(TI、AQ) N系の複合材料はAQ 成分を含むため、高温での酸化条件下で保護膜であるAQ2 O3 を生成することにより耐酸化性の向上が確認されており、該複合材料を括材被型した複合硬質材料は、従来の複合硬質材料(例えば基材上にTI Nを被覆したもの)に比べてクレータ

及びフランク摩耗量が少ないため、有望な切削工具用材料と考えられている。

しかしながら、(TI・AQ) Nの特定の組成、例えば(50at%Ti~50at%AQ) Nの組成の複合被膜を所望の基材上に直接被覆すると、基材と複合被膜との化学組成、結晶構造の相違からそれらの界面での構成ギャップにより密着性が不十分となったり、熱膨退係数のギャップにより熱応力下で界面から複合被膜が剥離する等の問題があった。

本発明は、上記従来の類節を解決するためになされたもので、耐酸化性の優れた(TI、AI) N組成を有する複合被膜を基材上にそれら界面でのクラックや剥離発生等を招くことなく良好に密音させた複合硬質材料、並びにかかる複合硬質材料を簡単な工程により製造し得る方法を提供しようとするものである。

[課題を解決するための手段]

本発明は、基材上に、該基材倒から A 』 量を段 階的もしくは連続的に増加させた(Ti, A 』)

オンピームを照射する時間を調節することにより 然着組成を制御することが可能となる。また、 電子ピームを用いる真空蒸音法の場合はダブルイ ス方式で電子ピームによりTiとAIを蒸着する がTiとAIとを連続的に蒸着することも可能 あり、適当な時間間隔をおいて蒸着することも可 能であり、組成制御も可能である。

前記イオン版より照射する窒素イオンは、蒸着と独立して操作することが可能である。このため、蒸着量と窒素イオンの相対的な組成比率は自由に調節でき、目的とする所定比率の(T)、Al)Nの被膜を形成することが可能であり、組成を段階的もしくは連続的に制御することが可能である。

[作用]

本発明によれば、基材上に、該基材側からAI 量を段階的もしくは連続的に増加させた(TII、AI)N系の組成構造を有する複合被膜を被覆することによって、基材と接する複合被膜の界面での極端な組成の落差に起因する複合被膜のクラックを訓練等の発生を防止できると共に基材に対す N系の組成構造を有する複合被膜を被覆したこと を特徴とする複合硬質材料である。

上記基材としては、例えば高速度調、超硬合金、サーメット等からなるものを挙げることができる。また、本発明方法は基材上にT!及びAIを蒸替すると同時にイオン あより 窒素イオンを 照別するイオンミキシング法により 波基材 側から AI 量を 段階的もしくは連続的に増加させた (TI・AI) N系の組成構造を育する複合被膜を形成することを特徴とする複合硬質材料の製造方法である。

上記TI、AIの茲若手段としては、ターゲットを利用したイオンとができる。 ではといることができる。 の方法では、 所定の化学組成を有する TI ー AI の金ターゲットを利用して、 以いは T ー A I 単体の金属ターゲットに 版を基材表面に 蒸谷 ロンピームを 照射して、 スパッタイオンピームの 加速 で E 、ピーム電流を 調節したり、ターゲットに T

る密替性を向上できる。また、 複合 被 照中の A 』 量を基材側から段階的もしくは連続的に増加させることによって、 最上層側の 被 膜部分中の A 』の T 」リッチ層への 拡散を抑制できるため、目的と した耐酸化性及び切削性能を有する 複合 被膜を基 材上に被覆した複合硬質材料を得ることができる。

更に、本発明によれば組成制御、組成の段階的 もしくは連続的な制御が容易なイオンミキシング 法を採用しているため、既述したような耐酸化性 及び切削性能を有する複合被膜を基材上に対して クラック等を発生せずに良好に密着、被覆した復 合硬質材料を簡単に製造することができる。

[実施例]

以下、本発明の実施例を詳細に説明する。 実施例 1

まず、基材としての30×30×2 mmの寸法の高速 度鋼板を用意し、この板をイオン照射と蒸着機能 を備えた真空チャンバ内のホルダに保持した。つ づいて、このチャンバ内を5×10<sup>-6</sup> torrに真空引 きした後、イオン顔から加速電圧5 k V の A r イ オンを引き出し、前記板に照射して表面が浄化のを対ののが処理を総した。次いては、では、ないのでは、では、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないで

比 纹 例 1

前記実施例 1 と同様な前処理を施した 高速度鋼板にダブルハース方式と窒素イオンの照射により厚さ4 μmの(50at% Ti - 50at% A 2 ) N の組成を持つ複合被膜を直接形成して複合硬質材料を製造した。なお、T」とA 2 の蒸替速度は失 3 . 0 人/sec 、窒素イオンの照射を加速電圧10

出したAFイオンを照射して前記チップにスパッ タ蒸着すると同時に他のイオン顔から窒素イオン を加速電圧 i 0 k V 、イオン電流密度 0.5 m A / cal の条件で引き出し、該スパック蒸費膜に照射して 厚さ2 μmの (75at% T I - 25at% A Q ) N 組成 を有する複合窒化物膜を形成した。次いで、こ の 俊 合 窒 化 物 膜 に 別 の 50 a t % T i - 50 a t % A l の ターゲットにスパッタイオン顔より加速電圧2.5 k V、イオン堪流1.5.Aで引出したAェイオンを 照射して前記チップにスパッタ蒸着すると同時に 他のイオン版から窒素イオンを加速電圧10k V 、 イオン電流密度 0.5 m A / cd の条件で引き出し、 波スパッタ族苔膜に照射して厚さ約2 μmの (50 at% T | - 50at% A Q ) N 組成を有する 複合 窒化 物膜を形成して複合硬質材料を製造した。 比 40 例 2

前記実施例 2 と同様に表面清浄化処理された T! N膜が被覆された超硬合金チップにスパッタ 蒸符と窒素イオンの照射により厚さ4 μmの(50 at% Ti - 50at% A 2 ) N組成を有する複合窒化 k V 、イオン電流密度 0.5 m A / cd の条件で行なった。

しかして、 真空チャンパから取出した本文 底例 1 及び比較例 1 の複合 硬質材料を切断し、 「版面を S E Mで収録した。 その特果、 比較例 1 の複合 で 質材料では高速度倒と複合 被 膜の 界面に 値かって るがマイクロクラックの発生が 認められた。 これ に対し、 本実 底例 1 の複合 硬質材料では 高速度 板と複合 被 膜 との 界面に も何等の 欠陥 も 世 なれ ず良好な被覆構造を有することが確認された。 実 施 例 2

一般的なCVD法によりTiN膜が被覆された 型硬合金チップをイオン照射と蒸着機能を解えた 真空チャンパ内のホルダに保持した。つづいて、 このチャンパ内を5×10<sup>-6</sup> torrに真空引きした後、 イオン源から加速電圧5kVのArイオンを引き 出し、前紀チップ表面に5分間照射して表面清浄 化のための前処理を施した。ひきつづき、75at 96 TI-25at %A2のターゲットにスパッタイオン 変より加速電圧3.5kV、イオン電流2.0Aで引

物膜のみを形成して複合硬質材料を製造した。

しかして、本実施例 2 及び比較例 2 の複合 便質材料により H 。 = 280 の S N C M 8 類を V = 180 m / min 、 f = 0.25 m / rev 、 t = 1.5 m (1回の切削時での切り込み量)の条件で切削した時の耐解耗性を調べた。その結果、本実施例 2 の複合硬質材料では10分間で V e = 0.15 m であったが、比較例 2 の複合硬質材料では10分間で V e = 0.25 m と 劣っており、しかも 括材である T i N 被 更超硬合 金チップと 複合 窒化物膜との界面で一部クラックの発生が 23 められた。

実施例3

30×30×2 mの T l 板を実施例 1 と同様な表面 清浄化処理を施し、電子ビームによるグフルハース方式により T l 、 A l の電子ビーム 滋着量をコントロールしながら、同時に窒素イオンを照射して多層の複合窒化物膜を形成した複合硬質材料を製造した。なお、各膜の組成、T i 及び A l の流着速度、窒素イオンの 照射時の 加速電圧、ビーム電流密度を下記第 1 表に示す。

	器器		1 10	1 00	3 00
	とオト茶品	アーム和電池政	0.5aA/cd	a	ď
		加速磁压	1 0 K V	10KV	10KV
<b>₽</b> 3	AKK普通度		*	1.5 Å /sec 1 0 K V	2.5 A /sec
T E	報 成 71 蒸光速度 44 探台速度		5.0 Å /sec	(75atXT1 - 25atXAI) N 8.5 A /sec	(50atXTI-50atXM)N 2.5A/sec 2.5A/sec 1 0 K V
			N	. 25at XAI ) N	50at XAI) N
			T1 N	(75atXT! -	(50at XT! -
			第1層	第2篇	迎6级

(TI, AI) N系の組成構造を有する複合被膜を被覆した複合硬質材料について説明したが、 話材の種類や結晶構造等により該話材側から AI 量を段階的もしくは連続的に減少させた (TI, AI) N系の組成構造を有する複合被膜を基材上に被覆したり、 AI 量を段階的もしくは連続的に増減させた複合被膜を基材上に被覆してもよい。

# [発明の効果]

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦

#### 比较到3

30×30×2 mmのT! 板を実施例1と同様な表面 清浄化処理を施した後、該T! 板上に上記第1表 の第3 層目の膜形成と同様な方法により厚さ3 μmの(50at% T! - 50at% A g ) N組成を有す る複合窒化物膜を直接形成して複合硬質材料を裂 造した。

しかして、本実施例3及び比較例3の複合硬質材料を夫々空気中で1700℃、300時間の酸化試験を行ない、酸化増量を調べた。その結果を下記第2表に示した。

第 2 表

	設 化 增 量
実施例3	20 μ g / cd
比較例3	95 µ g ∕ cai

上記第2表から明らかなように、本実施例3の 複合硬質材料は耐酸化性が極めて優れていること がわかる。

なお、上記実施例では基材上に抜基材側から A 2 量を段階的もしくは連続的に増大させた